# リチウムイオン電池のグラファイト負極の 表面被膜-SPMによる解析

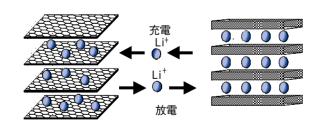
Surface Film Formation on Graphite Negative Electrode for Lithium Ion Batteries - Analysis by SPM

小久見 善 八\*

Zempachi Ogumi

#### 1 はじめに

リチウムイオン電池は**図1**に示すように、正極であるリチウム含有酸化物(主にLiCoO<sub>2</sub>)と負極であるグラファイトとの間で電解質溶液を介してリチウムイオンが移動する反応が電池反応となる。充電では正極から負極へリチウムイオンが移動し、放電では逆になる。もちろん、この反応が進行するとそれに伴って、正極と負極のホスト物質が酸化還元反応を受けて電気的中性が保たれる。



負極 グラファイト

イオン伝導相 有機電解液

正極 LiCoO<sub>2</sub>

## 図1 リチウムイオン電池の反応

Fig.1 A simplified reaction model of lithium ion batteries.

リチウムイオン電池の負極には発売当初は難黒鉛化性炭素材料が用いられていた。その大きな理由の一つは、グラファイトを用いるとリチウムの挿入ができなかったことである。その後、エチレンカーボネート(EC)系の電解液を使用することによってグラファイトにリチウムを挿入脱離できることがわかり、大きな容量を出すことができるグラファイトが負極として主に使用されるようになった。ここでは、EC系の溶媒によってリチウムが挿入できるようになったグラファイト負極上の被膜生成について、走査型トンネル顕微鏡(STM)と走査型原子間力顕微鏡(AFM)のような走査型プローブ顕微鏡(SPM)を用いて調べた我々の研究についてまとめる。

# 2 グラファイト負極の安定化と SEI

リチウムイオン電池のグラファイト負極は金属リチウムに対して 90 ~ 200 mV の電位を示すように、非常に強い還元力を示す。このような電位では熱力学的には殆どすべての有機物が還元される。また、金属酸化物や硫化物でも還元されるであろう。このような反応が続けば、高性能の電池とはならないはずである。それにも拘わらず、有機電解液を使用するリチウムイオン電池やリチウム金属一次電池が開発され優れた特性を示している。これは、負極表面に何らかの被膜が生成して電解液の還元に対して不動態化し、電解液の

<sup>\*</sup>京都大学大学院工学研究科物質エネルギー化学専攻

還元反応の速度が非常に遅くなり、実際上電解液など の還元反応が起こらなくなっているからである. しか し、電解液によってはリチウムのグラファイトへの挿 入反応が進行しない. リチウム一次電池の電解液に用 いられるプロピレンカーボネート (PC) を電解液に 用いると、図2に示すように、グラファイト中への リチウムの挿入が起こる電位には達することなく、0.8 V付近で電位が平坦になり、グラファイトの剥離が進 行する<sup>1)</sup>. リチウムが挿入するためには EC をベース とする電解液が必要である. この事実は. 溶媒によっ てその還元反応が異なり、PC系の電解液ではその分 解を抑制して電位をリチウムの挿入が進行する卑な 値まで下げることができないことを示している. すな わち、ECとPCは似た溶媒であるにも関わらず、グ ラファイト電極上におけるその還元的分解の挙動が大 きく異なっている。ECを用いた場合に生成する。リ チウムが挿入できるようにグラファイトの表面を不 活性化・安定化させる被膜を SEI (solid electrolyte interface)と呼んでいる<sup>2)</sup>. このSEI はリチウムイオ ンに対して導電性があり、一方、電子伝導性があって はならない. SEI はグラファイト負極にリチウムイオ ンの挿入・脱離が起こるためには必須のものであるが、 電解液の還元的分解反応によって生成している。その 反応に電荷が消費されることになり、これは不可逆容 量の原因となる.

層状構造をしており、リチウム挿入によってグラファイト層間化合物(GIC)を形成するグラファイト

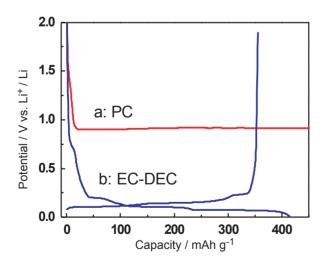


図 2 グラファイトへのリチウムの電気化学的挿入脱離 a: PC/LiClO<sub>4</sub> 電解液 b: EC-DEC/LiClO<sub>4</sub> 電解液

Fig.2 Typical charge and discharge curves of graphite in (a) PC/LiClO<sub>4</sub> and (b) EC-DEC/LiClO<sub>4</sub>.

のリチウムイオンの出入り口はそのエッジ面(端面) となる。エッジ面はベイサル面(基底面)に比べて多 くの反応に対して活性が高いことが知られている。リ チウム金属に近いような強い還元電位に曝されると. エッジ面はもとより、比較的活性の低いベイサル面 上でも電解液の還元が進行すると考えるのが自然であ る. すなわち、SEI ができるエッジ面だけでなく、ベ イサル面でも電解液の分解が進行する. EC 系電解液 ではこのベイサル面上の反応も初期だけに留まり、抑 制されることになる. リチウムの挿入・脱離に不活性 なベイサル面の表面に生成する被膜 passivating film はSEIのようにリチウムイオン伝導性は要求されな い. また、電子伝導性も不要である. もちろん、ベイ サル面の被膜生成に消費される電荷も不可逆容量の原 因になるので、リチウムの挿入・脱離に関与しないこ の被膜生成を極小にすることが不可逆容量の低減に繋 がる.

# 3 EC-DEC 系における溶媒和リチウムの挿入

高配向性熱分解黒鉛(HOPG)は結晶度の高い黒鉛であるが、その表面のベイサル面には多くのステップ構造がある。このステップ構造のエッジ面はグラファイトのエッジ面と本質的には同じであり、リチウムの挿入脱離の入り口となり得る。HOPGを用いてリチウムの挿入を行い、このステップエッジの近傍のモルフォロジーの変化を観察すれば、リチウム挿入による変化をその場で追跡することができる。

図3に示す電気化学 AFM (ECAFM), あるいは、 ECSTM をリチウム電池の研究に用いるグローブボッ クスの中に設置する. HOPG の電位を 1.1 V (vs. Li<sup>+</sup>/ Li) に設定すると**図4**に示すような像が得られる<sup>3)</sup>. 約 10 分後には高さ約3 nm のステップエッジから丘状構 造が前進していき、時間の経過とともに丘状構造の後 ろ側が剥がれていく. 丘状構造の高さは約1 nm であ る. リチウム GIC ではリチウム挿入によるの層間の 拡大は 0.05 nm 以下であることが報告されており、観 測された丘状構造の高さを説明するためには20層以 上に均等にリチウムが挿入したドメインが形成される ことが必要であるが、ステップエッジの高さから計算 される層厚さは約9層である.また、連続した層に均 等にリチウムが入ってドメインを構成すると考えるの はこれまでの GIC に関する結果と相容れない。一方, 表1に示すように、ある種の溶媒はリチウムイオンに

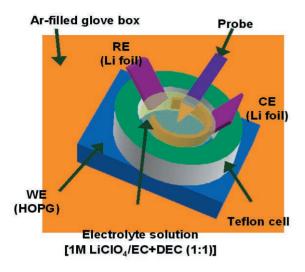


図3 グラファイト表面の SEI 生成を観察するその場 ECAFM

Fig.3 A schematic diagram of in situ ECAFM for analysis of SEI formation on graphite negative electrode.

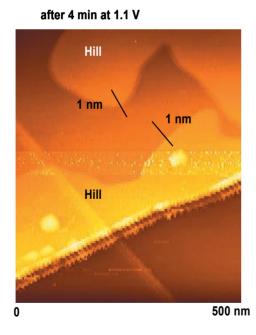


図4 EC-DEC 系電解液の SEI 生成初期過程の STM 像 Fig.4 An STM micrograph of initial stage of SEI formation on graphite observed at 4 min after potential step to 1.1 V.

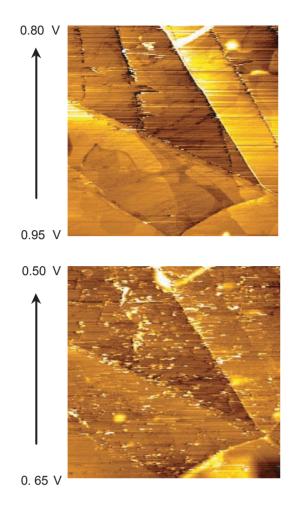
表 1 溶媒和アルカリ金属が挿入したグラファイト層間化合物の挿入面間隔

Table 1 Expansion of layer distance of graphite caused by solvent co-intercalation.

GIC	d į (nm)
Li(THF) <sub>1.4</sub> C <sub>6</sub>	0.918
Li(THF) <sub>2.3</sub> C <sub>12</sub>	0.909
Li(THF) <sub>3.4</sub> C <sub>18</sub>	0.910
Li(DME) <sub>2.8</sub> C <sub>33</sub>	0.397, 0.827
Na(THF) <sub>3.5</sub> C <sub>32</sub>	0.389
Na(DME) <sub>2.8</sub> C <sub>32</sub>	0.397, 0.842

溶媒和したまま挿入し、層間を1 nm 程度拡大させることが知られている。これらのことから、丘状構造が形成される EC-DEC の系では溶媒和したリチウムが挿入すると考えるのが妥当である。また、Besenhardらはディラトメーターを用いた研究から溶媒和リチウムの挿入を報告している $^4$ . なお、 $\mathbf{24}$  に示す丘状構造が AFM では観測されないとの報告もある $^5$ . しかし、それは測定に用いた電解液の純度が不十分であって、表面に別の被膜が形成しており、その被膜を観察しているからであると考えられる。電位を卑にしてベイサル面上に passivating film が生成した後でも、その被膜を除去することによって、AFM で $\mathbf{24}$  に見られる丘状構造を観察する事ができる.

電位をさらに低くすると STM では観察できなくな る. これはベイサル面に絶縁性の被膜が生成するこ とが原因と考えられる. AFM で観察すると、図5に 示すように、0.8 V 以下では丘状構造に加えて、高さ が10~数十nmに達する隆起構造が観察される. さ らに電位を下げると、表面が著しく粗になってくると ともに、沈殿物のような粒子の堆積が見られる. これ らの結果から、EC-DEC 系電解液を用いたグラファイ ト中へのリチウム挿入の初期過程は図6に示すよう に、溶媒和したリチウムが1V程度の電位から挿入 しはじめ、約1 nm の層間の拡張を引き起こす. それ による歪みのためにグラファイトの表面層が剥離しや すくなる. 挿入した溶媒和リチウムはさらに電位が低 くなると溶媒が還元的に分解する. それによって. 隆 起構造(我々はブリスター blister と呼んでいる)が 形成され、ステップエッジでは剥離が顕著になる. 還 元分解生成物あるいはそれと電解液との反応生成物が ステップエッジの部分で層間に生成する. これがリチ ウムイオン伝導性の被膜 - solid electrolyte interface.



#### 図5 EC-DEC 系電解液での AFM 像

Fig.5 AFM images in EC-DEC at different potential during the first potential scan in 1 M LiClO $_4$  / EC-DEC.

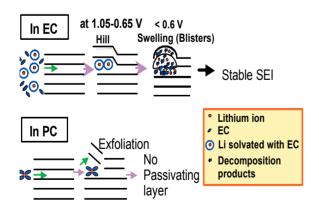


図 6 EC-DEC 系および PC 系電解系での SEI 生成の初期過程

Fig.6 Models of initial stage of SEI formation in EC-DEC and PC systems.

SEI - となる. この被膜. SEI. はリチウムイオンに 対する導電性を示し、電子導電性は持たない. 溶媒和 したリチウムイオンは SEI を通過するにあたって脱 溶媒和をする。したがって、SEI 生成後は溶媒の共挿 入は進行しなくなり、溶媒の還元に基づく丘状構造や blister の生成は停止する. しかし. 充放電に伴う体 積変化によってグラファイト層に歪みが生じ、これに よって SEI が破壊されると、上と同様の反応が再び 進行してSEIの修復が行われる.一方,PCを用いると、 SEI の生成は行われずに、グラファイト層の剥離が進 行する. これは、PCでは溶媒の共挿入が進行すると 歪みが大きくなり、溶媒の還元的分解とグラファイト 層の剥離が直ちに進行し、SEI のような不動態化被膜 が生成しない、すなわち、溶媒の還元的分解に起因す る SEI 被膜の生成と剥離が競争的に進行するが、PC を溶媒にすると、剥離の方が優先的に進行し、安定化 被膜が生成しないと考えている。溶媒の還元に対する 安定性, 溶媒和能, グラファイトに侵入する溶媒和リ チウムイオンのサイズ、グラファイトの歪み許容性な どが SEI の生成の因子となっていると考えられる.

## 4 SEIの生成と溶媒の影響

#### 4.1 共溶媒の影響

上述のように、グラファイト表面の安定化には電解液の反応が大きく関与している。したがって、電解液の組成は大きな影響を与える。EC系の電解系で、共溶媒のSEI生成過程に与える影響が調べられている。

図7にEC, EC-DMC, EC-DEC の系で $0 \text{ V} \sim 2.8$ Vの間で1サイクル電位走査をした後の表面の AFM 像を示す<sup>6)</sup>. 図から判るように、溶媒の共挿入の結 果を示す blister や丘状構造の生成は EC-DEC > EC-DMC ~ ECの順番となる. Raman 分光法を用いた溶 媒和に関する研究結果は、EC-DECではECとDEC が 3/1 程度の比で Li<sup>+</sup> に溶媒和する. すなわち. DEC も Li<sup>+</sup> に溶媒和することができる. いっぽう, EC-DMC の系では DMC の溶媒和への関与は極めてわず かであることが明らかにされている 6. この溶媒和の 違いがSEI生成に先行する溶媒和リチウムの挿入に 影響すると考えられる. すなわち, 直鎖のカーボネー トが溶媒和した Li<sup>+</sup> イオンは共挿入が起こりやすいこ とが示唆される。この推定は、DMC 単独溶媒の系で は EC-DEC の系と同程度に溶媒の共挿入が起こると いう実験結果から支持される6).

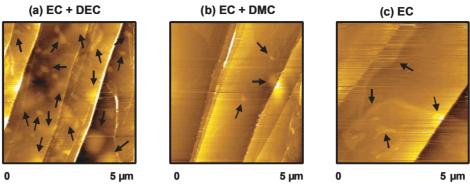


図 7 1M LiCIO<sub>4</sub>- を含む (a) EC+DEC, (b) EC+DMC, (c) EC 中で 0.5 mV/s で CV 1 cycle 後の AFM 像(2.9 V で観察)

Fig.7 AFM images at 2.9 V after the first potential scanning to 0 V at 0.5 mV/s in systems containing 1 mol/I LiClO $_4$ - in (a): EC+DEC, (b): EC+DMC, (c): EC.

#### 4.2 クラウンエーテルの添加効果

リチウムの溶媒和が重要であるなら、Li<sup>+</sup>と安定な 錯体をつくるクラウンエーテル 12-crown-4 が共存すると、溶媒和が大きな影響を受ける。実際、PC に 12-crown-4 を添加するとグラファイトにリチウムを 挿入脱離できることが報告されている  $^{7}$ . これは溶媒 和リチウムの代わりに 12-crown-4 - Li<sup>+</sup> 錯体が溶媒和 リチウムの挿入の進行する電位よりも貴な電位で進行 することが図8に示すように SPM を用いた観察で確認されている。この場合、丘状構造が 1.0~V~以下で見られる。グラファイトに挿入されたこの 12-crown-4 - Li<sup>+</sup> が還元的に分解を受けて SEI の生成が進行し、Li<sup>+</sup>



図8 12-crown-4 を添加した PC 電解液中で HOPG を 0.7 V に 1 分間保持した後に観察される STM像 (3.0 V で観察) 1 M LiClO $_4$ /PC + 0.5 M 12-crown-4.

Fig.8 An STM image of HOPG surface observed at 3.0 V after maintaining potential at 0S.7 V for 1 min in 1 M LiClO<sub>4</sub>/PC containing 0.5 M 12-crown-4.

の挿入が可能となると考えられる <sup>8</sup>. EC-DECの系に 12-crown-4 を添加した場合にも、12-crown-4 - Li<sup>+</sup> の 挿入が進行する。12-crown-4 - Li<sup>+</sup> は溶媒和リチウム に比べて安定で、挿入したのちの電位が貴になると再 び溶液中に脱離するが、挿入した 12-crown-4 - Li<sup>+</sup> の 一部が部分的に分解したり、安定なサイトに捕捉されたりしてグラファイト層間に取り残され、高さ約 1 nm の丘状構造が形成される。しかしステップエッジ近くの 12-crown-4 - Li<sup>+</sup> は貴な電位で脱離するので、丘状構造はステップエッジ近傍では形成されず、丘状構造が basal plane に島状に残ることになる。この結果は図9に示すように、挿入した 12-crown-4 - Li<sup>+</sup> は比較的自由に層間を運動することができることを示している

# 4.3 トリフルオロメチル化プロピレンカーボネート (TFPC) 溶媒

PCの methyl 基を trifluoromethyl 基に変えると Li<sup>+</sup>を挿入・脱離することができる  $^9$  . この場合, **図 10** に示すように、溶媒和リチウムの挿入を示す丘状構造 や blister の生成は認められない。 TFPC は PC よりもサイズが大きく、共挿入が起こるとグラファイト層 の歪みは PC の場合よりも大きく、容易に剥離が進行するはずである。 一方、 TFPC は CF $_3$  基の電子吸引性のために PC より還元され易く、ドナー数も小さいと考えられる。 これらの点を考慮すると、 TFPC の場合には、溶媒共挿入反応と競争して TFPC が還元的に分解を受けて、これによって安定な被膜 – SEI と言って良いであろう – が形成され脱溶媒和された Li<sup>+</sup>の挿入が可能となると現在のところ推定される。

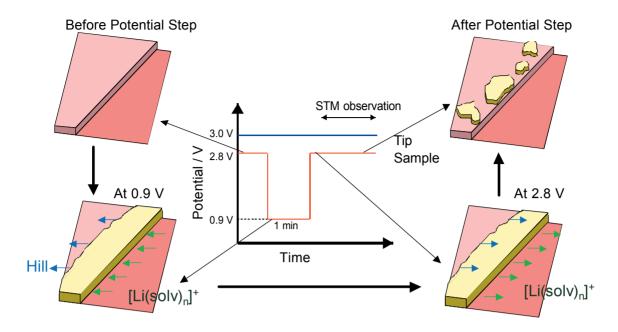


図 9 12-crown-4 を添加した系における crown-Li $^+$  錯体のグラファイトへの挿入と反応

Fig.9 A model of lithium insertion into graphite in the presence of 12-crown-4.

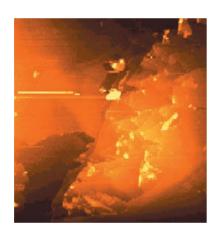


図 10 1 M LiCIO<sub>4</sub> - TFPC 電解液中で 1.0 V に保持 した HOPG の AFM 像

Fig.10 An AFM image of HOPG after polarized at 1.0 V in  $1 \text{ M LiClO}_4$  - TFPC.

# 5 表面被膜の成長

SEIの生成はグラファイト中にリチウムイオンが挿入されるためには必須であるが、その生成のために消費される電荷は不可逆容量として電池の性能を低下させる。この SEI 生成に加えて、Li<sup>+</sup>の挿入・脱離反応には関与しないグラファイトのベイサル面上でも電解液の還元的分解反応が進行する。この分解反応は電池の自己放電になり、それに消費される電荷は不可逆容

量となって容量低下を招く、保存寿命の長い電池とするためにはこの反応が抑制されなければならない、そのためには、分解生成物が表面に蓄積して更なる分解と膜の成長を抑制する passivating film として働くことが必要である.

Contact mode の AFM 観察をすると、プローブの 走引によって表面が摩耗するので、表面被膜が取り除 かれる. これを用いて、表面被膜の成長を観察する ことができる. **図11** に示すように、2.8 V と 0 V の 間で1回電位走査をした結果,約40 nmの被膜が生 成することがわかる 10). この場合, プローブの走査 で表面層が取り除かれた部分とその周りの部分との 高低差が沈積層の存在を示す. SEI の部分は変化しな く、安定であることを示す、さらに次の電位走査を繰 り返すと、被膜が取り除かれた部分に再び被膜が生成 し,他の部分では約30 nm だけ被膜が成長する.こ の passivating film はある程度成長すればその成長速 度が無視できるようになると推定されるが、どこまで 成長するかは電解液の性質と電極炭素材量の性質に依 存する. この被膜の成長は充電保存時の容量低下を招 くだけでなく、充電容量を低下させる。さらに、電子 導電性の低い被膜の成長が合剤電極内の粒子間の接触 抵抗を大きくし、電極の有効表面積の低下を招く. こ れが電池の内部抵抗の増加、出入力特性や容量の低下 を招くことになる.

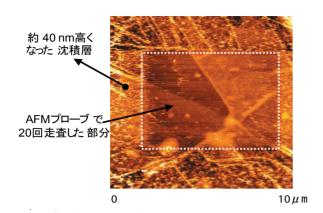


図 11 Passivating film の存在を示す拡張された AFM 像

Fig. 11 Expanded AFM view of HOPG. Precipitating layer is formed during preceding potential scanning and the morphology formed under precipitating layer is stable.

# 6 添加物の効果

電解液中の成分が還元的に分解してSEIやpassivating filmが生成するが、これらに消費される電荷はできるだけ少なく、また、被膜の厚さも薄いことが望まれる。このような観点から、安定なSEIやpassivating filmを電荷消費量を少なくして迅速に生成するような添加物が望まれる。これまで、電池の特性を向上させる添加物には多くのものが提案されている。その中で、ビニレンカーボネート(VC)、エチレンサルファイト(ES)やフルオロエチレンカーボネート(FEC)が有効であることが知られている 11-13.

これらの添加物は**図 12** に示すように,それぞれ,VC: 1.35 V, ES: 1.05 V, FEC: 1.15 V で還元分解の電流が観測される  $^{14)}$ . 2 nd CV では,電解液の還元が抑制されており,添加物によって HOPG 表面に SEI が生成していることが示唆される. すなわち,EC あるいは PC 系で溶媒の共挿入が始まる電位よりも貴な電位で還元反応が始まる.この還元反応による生成物がSEI あるいは passivating film として働き,PC を溶媒に用いてもリチウムの挿入脱離が進行するようになる.

図13に示すように、リチウムの挿入が起こっても溶媒共挿入に起因する丘状構造や blister は認められない. これら3種の添加物では、生成する被膜の厚さが異なる. VC が最も薄い高密度の被膜を与える. 詳細は明らかではないが、VC が2官能基モノマーとして働き、安定な重合物被膜が表面に生成することによると考えている.

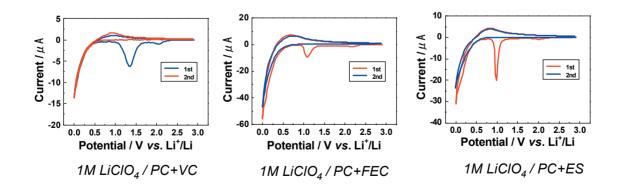


図 12 1M LiCIO<sub>4</sub>-PC 電解液に 3 質量 % の VC, FEC, ES を添加した系での HOPG の CV Fig.12 Cyclic voltammograms in 1M LiCIO<sub>4</sub> - PC with addition of VC, FEC, and ES (3% addition).

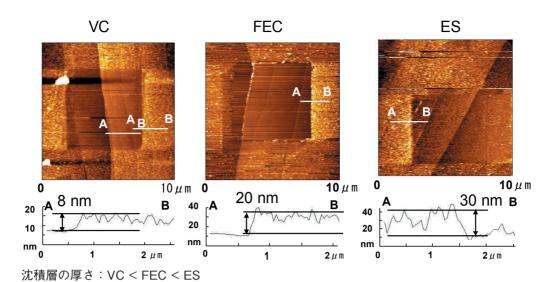


図 13  $1M \ LiClO_4$  - PC 電解液に 3 質量 % の VC, FEC, ES を添加した系での HOPG の AFM 像 Fig.13 AFM images in  $1M \ LiClO_4$  - PC with addition of VC, FEC, and ES (3% addition). Thickness of precipitating layer: VC < FEC < ES

# 7 終わりに

グラファイトがリチウムイオン電池の負極として機能するためには、Li<sup>+</sup>の挿入を可能にする SEI の生成と、電解液の還元分解を抑制する passivating film が表面を被覆することが必要である。電解液の性質に依存して、また、電解液への添加物の性質依存してSEI の生成過程とその特性は異なるが、溶媒和したLi<sup>+</sup>を脱溶媒和させてグラファイト中に入る通路として作用する。一方、passivating film は電解液のさらなる分解を抑制する機能が求められる。SEI ならびにpassivating film を生成するのに要する電荷量ができるだけ小さく、また、生成した film の成長が遅い電解液の開発が望まれる。電池の高温特性を向上させるためには、このような film は高温でも安定であることが必要であろう。

#### 文 献

- 1) M. Inaba, Z. Siroma, Y. Kawatate, A. Funabiki, and Z. Ogumi, *J. Power Sources*, **68**, 221 (1997).
- 2) E. Peled, J. Electrochem. Soc, 126, 2047 (1979).
- 3) M. Inaba, Z. Siroma, A. Funabiki, Z. Ogumi, T. Abe, Y. Mizutani, and M. Asano, *Langmuir*, **12**, 1535 (1996).
- 4) J. O. Besenhard, M. Winter, J. Yang, and W. Biberacher, *J. Power Sources*, **54**, 228 (1995).

- 5) K. A. Hirasawa, T. Sato, H. Asahina, S. Yamaguchi, and S. Mori, *J. Electrochem. Soc*, **144**, L81 (1997).
- 6) S.-K. Jeong, M. Inaba, Y. Iriyama, T. Abe, and Z. Ogumi, *Electrochim. Acta*, 47, 1975 (2002).
- Z. X. Shu, R. S. McMillan, and J. J. Murray, J. Electrochem. Soc, 140, 922 (1993).
- 8) M. Inaba, Y. Kawatate, A. Funabiki, S.-K. Jeong, T. Abe, and Z. Ogumi, *Electrochemistry*, **67**, 1153 (1999)
- M. Inaba, Y. Kawatate, A. Funabiki, S.-K. Jeong, T. Abe, and Z. Ogumi, *Electrochim. Acta*, 45, 99 (1999).
- S.-K. Jeong, M. Inaba, T. Abe, and Z. Ogumi, J. Electrochem. Soc., 148, A989 (2001).
- 11) P. Biensan, J. M. Bodet, F. Perton, M. Broussely, C. Jehoulet, S. Barusseau, S. Herreyre, and B. Simon, Extended Abstracts of The 10th International Meeting on Lithium Batteries, Como, Italy (2000). The Electrochemical Society, Pennigton, NJ, Abs. No. 286 (2000).
- 12) G. H. Wrodnigg, J. O. Besenhard, and M. Winter, *J. Electrochem. Soc.*, **146**, 470 (1999).
- 13) R. McMillan, H. Slegr, Z. X. Shu, and W. Wang, *J. Power Sources*, **81 82**, 20 (1999).
- S.-K. Jeong, M. Inaba, R. Mogi, Y. Iriyama, T. Abe, and Z. Ogumi, *Langmuir*, 17, 8281 (2001).